



URZĄD
PATENTOWY
PRL

OPIS PATENTOWY

55382

Patent dodatkowy
do patentu _____

Kl. 57 c, 5

Zgłoszono: 26. XI. 1965 (P 111 780)

Pierwszeństwo: _____

MKP ~~G 03 d~~

G 03 c, 1/74

Opublikowano: 17. IV. 1968

CZYTELNIA

UKD
Urząd Patentowy
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Twórca wynalazku: inż. Romuald Puciul

Właściciel patentu: Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne, Bydgoszcz (Polska)

Wanienka do boczego stykowego obłewu podłoża emulsją fotograficzną

1

Przedmiotem wynalazku jest wanienka do bocz-
nego stykowego obłewu podłoża emulsją fotogra-
ficzną.

Znany sposób drugiego obłewu podłoża papiero-
wego, folii itp. emulsją fotograficzną odbywa się
przy pomocy urządzenia typu „Rollgang”. Składa
się ono z szeregow wałków rozmieszczonych lu-
kiem koło siebie i posiadających własny napęd.
Wałki te znajdują się w skrzyni próżniowej i dzie-
ki temu przyssane podłoże — wstęga papierowa lub
folia z sztucznego tworzywa — przez próżnię, wcho-
dzi pod ostrym kątem do wanienki w procesie
technologicznym drugiego obłewu podłoża emulsją
fotograficzną.

Ujemną cechą tego urządzenia jest jego skompli-
kowana budowa oraz kłopotliwe działanie w pro-
cesie drugiego obłewu.

Innym znanym urządzeniem służącym do drugie-
go obłewu podłoża, jest zespół dwóch wałków w ma-
szynie obłewniczej, które są umieszczone koło wa-
nienki i sposobem narzutowym — przy działaniu
wałka pomocniczego — następuje proces obłewu
podłoża.

Ujemną cechą tego urządzenia w sposobie na-
rzutowym obłewu jest to, że nie umożliwia nano-
szenia na podłoże cienkich i równomiernych warstw
emulsyjnych.

Znany jest też sposób stykowego obłewu podłoża,
opisany w patencie radzieckim nr 118703, którego
istotę stanowi spoziomowany wałek, po którym

2

przesuwa się opięta wstęga podłoża, wałek umiesz-
czony jest równolegle ponad krawędzią obłewni-
czą wanienki obłewniczej. Wstęga podłoża, prze-
suwana po spoziomowanym wałku, tworzy kąt
ostry lub kąt prosty.

Ujemną cechą tego sposobu jest przede wszyst-
kim źle dobrany kąt, jaki tworzy wstęga podłoża
na spoziomowanym wałku, wskutek czego nanie-
siona emulsja fotograficzna na podłoże daje w prze-
kroju podłużnym niedopuszczalną falistą linię ho-
ryzontalną.

Istota wynalazku polega na tym, że spoziomowany
wałek, po którym biegnie opięta wstęga podłoża,
jest umieszczony z boku krawędzi obłewniczej wa-
nienki, co umożliwia przy obłewie prowadzenie
wstęgi po wałku pod rozwartym kątem alfa o do-
wolnej wartości, a przy odpowiednim wyregulo-
waniu położenia wałka osiąga się prowadzenie
wstęgi równoległe do krawędzi obłewniczej, elimi-
nując w ten sposób skrzywienie biegu wstęgi.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kładzie wykonania na rysunku, przedstawiającym
przekrój poprzeczny wanienki obłewniczej.

Według wynalazku konstrukcja wanienki stano-
wi przedmiot mający wlewną misę 1, ogrzewaną
przeponowo, posiadającą obłewniczą krawędź 2
wykonaną w ten sposób, że jej przekrój poprzeczny
przedstawia górny kontur jako linię prostą, oraz
rurę 3 o tak dobranej wysokości aby tworzyła
przelew dla masy emulsyjnej dopływającej pozio-

mym przewodem 4. Wanienka jest wyposażona w podstawę 5 regulowaną mechanicznie w pionie i w poziomie tak, aby można było wanienkę ustawić równoległą do spóźmowanego wałka 6, którego zbliżenie i oddalenie skośne w dół jest regulowane w stosunku do krawędzi 2, dla ustalenia kąta alfa biegnącej wstęgi podłoża 7.

Funkcjonalność urządzenia polega na stałym i równomiernym dopływie masy emulsyjnej przewodem 4 do wlewny misy 1, w której powstały nadmiar masy spływa na zewnątrz przelewową rurą 3. Utworzony na krawędzi 2 menisk emulsji 8 styka się nieprzerwanie z powierzchnią podłoża 7, przesuwanego na wałku 6, odpowiednio wyregulowanym w zależności od potrzeby nastawienia wymaganego kąta alfa.

Zaletą wanienki jest możliwość prowadzenia bocz-

nego stykowego oblewu podłoża masą emulsyjną, przez prowadzenie podłoża pod dowolnym kątem rozwartym, co powoduje równomierne nakładanie się emulsji na podłoże, dające w przekroju podłużnym prostą linię horyzontalną.

Zastrzeżenie patentowe

10 Wanienka do bocznego stykowego oblewu podłoża emulsją fotograficzną, posiadająca część wlewną, łąźnię wodną, rurę przelewową i regulowaną podstawę, **znamienna tym**, że jest zaopatrzona w spoziomowaną, płaską krawędź (2) służącą do bocznego stykowego oblewu, umieszczoną poniżej osi wałka (6), usytuowanego równoległe do krawędzi (2).

